PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-335061

(43) Date of publication of application: 25.11.2003

(51)Int.CI.

B41M 5/26 G11B 7/24 // C09B 23/00

(21)Application number: 2002-144142

(71)Applicant : ASAHI DENKA KOGYO KK

(22)Date of filing:

20.05.2002

(72)Inventor: YANO TORU

SHIGENO KOICHI OKADA MITSUHIRO **FUSHIMI TOMONORI**

(54) OPTICAL RECORDING MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical recording material for an optical recording medium having an enough fastness to light.

SOLUTION: In the optical recording medium in which an optical recording layer is formed on a substrate, the optical recording material which is used for the optical recording layer, comprises a polymethine compound consisting of an anion of formula (I) (wherein Y0 is a hydrogen atom, a 1-8C alkyl group or a 6-30C aryl group) and a polymethine cation.

女中、Yai、水上町1、火車線1~8のブルキル構では成本値で

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.02.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-335061

(P2003-335061A)

(43)公開日 平成15年11月25日 (2003.11.25)

l 月 FI	テーマコート*(参考)
G11E	3 7/24 516 2 H 1 1 1
C09E	3 23/00 L 4H056
B 4 1 N	M 5/26 Y 5 D 0 2 9
審査請は	求 未請求 請求項の数 6 OL (全 18 頁)
14142(P2002—144142) (71)出版	頭人 000000387 旭電化工業株式会社
20日 (2002. 5. 20)	東京都荒川区東尾久7丁目2番35号
(72)発明	明者 矢野 亨
	東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電 化工業株式会社内
(72)発明	明者、滋野、浩一
	東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電
	化工業株式会社内
(74)代	理人 100076532
	弁理士 羽鳥 修
	C 0 9 E B 4 1 M 審查請: 14142(P2002-144142) (71)出版 120日(2002. 5. 20) (72)発統

(54) 【発明の名称】 光学記録材料

(57)【要約】

【課題】 充分な光堅牢性を有する光学記録媒体用の光 学記録材料を提供すること。

【解決手段】 基体上に光学記録層が形成された光学記*

* 録媒体において、該光学記録層に用いられ、下記一般式 (I)で表されるアニオンとポリメチンカチオンとから なるポリメチン化合物を含有してなる光学記録材料。 【化1】

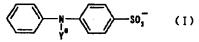
(式中、Y⁰は、水素原子、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基又は炭素数 6 ~ 3 0 のア リール基を表す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体上に光学記録層が形成された光学記録媒体において、該光学記録層に用いられ、下記一般式*

1

* (I)で表されるアニオンとポリメチンカチオンとから なるポリメチン化合物を含有してなる光学記録材料。 【化1】



(式中、 Y^0 は、水素原子、炭素数 $1 \sim 8$ のアルキル基又は炭素数 $6 \sim 30$ のアリール基を表す。)

【請求項2】 上記ポリメチン化合物が下記一般式(I 10※料。

1) で表されるものである請求項1記載の光学記録材 ※ 【化2】

$$\left(\begin{array}{c} A \\ \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} A \\ \end{array}\right) \left(\begin{array}{$$

(式中、環Aは、下記群 I の(a)~(e)のいずれかで表される基であり、環A'は、下記群 II の(a')~(e')のいずれかで表される基であり、Qは、トリメチン、ペンタメチン又はヘプタメチン鎖を構成する、鎖中に環構造を含んでもよい連結基を表し、Y°は、上記一般式(I)におけるものと同じである。)

$$\begin{array}{c} (B_1) \\ (B_1)^{L} \\ (B_1)^{L} \\ (B_2)^{L} \\ (B_1)^{L} \\ (B_2)^{L} \\ (B_1)^{L} \\ (B_2)^{L} \\ (B_2)^{L} \\ (B_1)^{L} \\ (B_2)^{L} \\ (B_2)^{L} \\ (B_1)^{L} \\ (B_2)^{L} \\ (B$$

(式中、環B及び環B'は、ベンゼン環、ナフタレン環又はピリジン環を表し、R¹及びR¹'は、ハロゲン原子、二トロ基、シアノ基、炭素数6~30のアリール基、炭素数1~8のアルキル基又は炭素数1~8のアルコキシ基を表し、R²及びR²'は、水素原子、ハロゲン原子、炭素数6~30のアリール基又は炭素数1~8のアルキル基を表し、R³~R³及びR³'~R³'は、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~8のアルキル基又は隣の置換基と縮合環を形成する基を表し、X及びX'は、酸素原子、硫黄原子、セレン原子、プロパン-2、2-ジイル、プタン-2、2-ジイル、3-フェニルプロパン-1、1-ジイル、炭素数3~6のシクロアルカン-1、1-ジイル、-NH-又は-NY²-を表し、Y及びY'は、水素原子又は炭素数1~30の有機基を表し、Y²は炭素数1~30の有機基を表し、r及びr'は0~4の整数を表す。)

【請求項3】 上記連結基Qが下記群IIIの(1)~ 50 (6)のいずれかで表される基である請求項2記載の光

学記録材料。

*【化3】 群Ⅲ (1) (2) (3) (4) (5)

(式中、R¹⁰及びR¹¹は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、炭 素数6~30のアリール基、ジフェニルアミノ基又は炭素数1~8のアルキル基 を表し、2は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、炭素数6~30のアリール 基又は炭素数1~8のアルキル基を表す。)

【請求項4】 上記環Aが上記(a)又は(d)で表さ れる基であり、上記環A'が上記(a')又は(d') で表される基である請求項2又は3記載の光学記録材 料。

3

【請求項5】 上記連結基Qが上記(1)又は(2)で 表される基である請求項3又は4記載の光学記録材料。 【請求項6】 基体上に、請求項1~5のいずれかに記 する光学記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

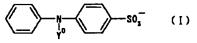
【発明の属する技術分野】本発明は、情報をレーザ等に よる熱的情報パターンとして付与することにより記録す る光学記録媒体に使用される光学記録材料に関し、詳し くは、レーザ等により髙密度の光学記録及び再生が可能 な光学記録媒体に使用される光学記録材料に関する。 [0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】光学記 **録媒体は、一般に記録容量が大きく、記録又は再生が非** 接触で行われる等、優れた特徴を有することから広く普 及している。WORM、CD-R、DVD-R等の追記 型の光ディスクでは、記録層の微少面積にレーザを集光 させ、記録層の性状を変えて記録し、未記録部分との反

【0003】光ディスクに代表される光学記録媒体の記 録層には、記録層を形成するのが容易なので、有機系の 色素化合物が使用されており、特にポリメチン化合物が 感度が高く、高速化に対応できることから検討されてい

射光量の違いによって再生を行っている。

【0004】ポリメチン化合物は、ポリメチン構造を有 するカチオン及びその対イオンであるアニオンにより構 成されており、対イオンであるアニオンとしては、ヨウ※



※素、臭素、塩素等のハロゲンアニオン;過塩素酸アニオ ン、塩素酸アニオン、チオシアン酸アニオン、六フッ化 リンアニオン、六フッ化アンチモンアニオン、四フッ化 ホウ素アニオン等の無機系アニオン、ベンゼンスルホン 酸アニオン、トルエンスルホン酸アニオン、トリフルオ ロメタンスルホン酸アニオン等の有機スルホン酸アニオ ン等が使用されており、これらは、特開2001-20 載の光学記録材料からなる薄膜を形成したことを特徴と 20 9969号公報、特開2001-322354号公報、 特開2000-108510号公報、特開2000-1 68233号公報、特開平10-235999号公報、 特開平10-337959号公報等に記載されている。 【0005】しかし、上記のアニオンを用いたポリメチ ン化合物は、日光や自然光に対する記録の保存安定性 (以降光堅牢性と記載することもある) が不充分である という問題点を有している。

> 【0006】従って、本発明の目的は、充分な光堅牢性 を有する光学記録媒体用の光学記録材料を提供すること にある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、検討を重 ねた結果、対イオンに特定の分子構造を有するアニオン を用いたポリメチン化合物が、上記課題を解決し得ると とを知見し、本発明に到達した。

【0008】即ち、本発明は、基体上に光学記録層が形 成された光学記録媒体において、該光学記録層に用いら れ、下記一般式(I)で表されるアニオンとポリメチン カチオンとからなるポリメチン化合物を含有してなる光 学記録材料、及び、基体上に、該光学記録材料からなる 薄膜を形成したことを特徴とする光学記録媒体を提供す るものである。

【化4】

(式中、Y°は、水素原子、炭素数1~8のアルキル基又は炭素数6~30のア リール基を表す。〉

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好ましい実施形態 について詳細に説明する。

【0010】本発明に係るポリメチン化合物は、上記一 般式(I)で表されるアニオンを対イオンとしたもので あれば、特に制限を受けるものではないが、該ポリメチ ン化合物を構成するポリメチンカチオンがその両端に環* *構造を有する、下記一般式(II)で表されるポリメチン 化合物が、半導体レーザを用いる光学記録材料として、 記録ピットを形成するのに適する光学特性及び熱的特性 を有するので好ましい。

[0011] [化5]

$$\left(\begin{array}{c} A \\ \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} A \\ \end{array}\right) \left(\begin{array}{$$

(式中、環Aは、下記群Iの(a)~(e)のいずれかで表される基であり、環 A'は、下記群 II の(a')~(e')のいずれかで表される基であり、Qは、ト リメチン、ペンタメチン又はヘプタメチン鎖を構成する、鎖中に環構造を含んで もよい連結基を表し、Yºは、上記一般式(I)におけるものと同じである。)

(式中、環B及び環B'は、ペンゼン環、ナフタレン環又はピリジン環を表し、 R^{1} 及び R^{1} は、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、炭素数 $6 \sim 3$ 0 のアリー ル基、炭素数 $1\sim8$ のアルキル基又は炭素数 $1\sim8$ のアルコキシ基を表し、 R^2 及びR²,は、水素原子、ハロゲン原子、炭素数6~30のアリール基又は炭素 数1~8のアルキル基を表し、R³~R³及びR³'~R³'は、水素原子、ハロゲ ン原子、炭素数1~8のアルキル基又は隣の置換基と縮合環を形成する基を表し、 X及びX'は、酸素原子、硫黄原子、セレン原子、プロパン-2,2-ジイル、 ブタンー2、2-ジイル、3-フェニルプロパン-1、1-ジイル、炭素数3~ 6のシクロアルカン-1、1-ジイル、-NH-又は-NY2-を表し、Y及び .Y'は、水素原子又は炭素数1~30の有機基を表し、Y2は炭素数1~30の 有機基を表し、 r 及び r ' は 0 ~ 4 の整数を表す。)

【0012】上記一般式 (I) 及び (II) において、Y° で表される炭素数1~8のアルキル基としては、メチ ル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、第二ブ チル、第三ブチル、イソブチル、アミル、イソアミル、 第三アミル、ヘキシル、シクロヘキシル、シクロヘキシ 50 ェニル、ナフチル、2-メチルフェニル、3-メチルフ

ルメチル、2-シクロヘキシルエチル、ヘプチル、イソ ヘプチル、第三ヘプチル、3-ヘプチル、n-オクチ ル、イソオクチル、第三オクチル、2-エチルヘキシル が挙げられ、炭素数6~30のアリール基としては、フ

ェニル、4-メチルフェニル、4-ビニルフェニル、3 イソプロピルフェニル、4 - イソプロピルフェニル、 4-ブチルフェニル、4-イソブチルフェニル、4-第 三プチルフェニル、4-ヘキシルフェニル、4-シクロ ヘキシルフェニル、4-オクチルフェニル、4-(2-エチルヘキシル)フェニル、4-ステアリルフェニル、 2. 3-ジメチルフェニル、2. 4-ジメチルフェニ ル、2、5-ジメチルフェニル、2、6-ジメチルフェ ニル、3、4-ジメチルフェニル、3、5-ジメチルフ ェニル、2、4-ジ第三ブチルフェニル、2、5-ジ第 10 三ブチルフェニル、2,6-ジー第三ブチルフェニル、 2, 4-ジ第三ペンチルフェニル、2,5-ジ第三アミ ルフェニル、2,5-ジ第三オクチルフェニル、2,4 ジクミルフェニル、シクロヘキシルフェニル、ピフェ ニル、2,4,5-トリメチルフェニルが挙げられる。 【0013】上記一般式(II)において、R1及びR11 で表されるハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭 素、ヨウ素が挙げられ、炭素数6~30のアリール基及 び炭素数1~8のアルキル基としては、上記Y°として としては、メチルオキシ、エチルオキシ、イソプロビル オキシ、プロビルオキシ、ブチルオキシ、ペンチルオキ シ、イソベンチルオキシ、ヘキシルオキシ、ヘプチルオ キシ、オクチルオキシ、2-エチルヘキシルオキシが挙 げられる。R'及びR''で表されるハロゲン原子、炭素 数6~30のアリール基及び炭素数1~8のアルキル基 としては、上記R'として例示したものが挙げられる。 また、R'~R'及びR''~R''で表されるハロゲン原 子及び炭素数1~8で表されるアルキル基としては、上 記R'として例示したものが挙げられ、隣の置換基と縮 合環を形成する基としては、ベンゼン、ナフタレン、ク ロロベンゼン、プロモベンゼン、メチルベンゼン、エチ ルベンゼン、メトキシベンゼン、エトキシベンゼン等の 芳香族環; フラン環、ベンゾフラン環、ピロール環、チ オフエン環、ピリジン環、キノリン環、チアゾール環等 の複素環;シクロプロパン、シクロブタン、シクロペン タン、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタ ン等の脂肪族環が挙げられる。

【0014】X及びX'で表される炭素数3~6のシク ロアルカン-1, 1-ジイルとしては、シクロプロパン 40 ロパン-2, 2-ジイル、ブタン-2, 2-ジイル、3 -1, 1-ジイル、シクロブタン-1, 1-ジイル、 2, 4-ジメチルシクロプタン-1, 1-ジイル、3-ジメチルシクロブタン-1,1-ジイル、シクロペンタ ン-1,1-ジイル、シクロヘキサン-1,1-ジイル が挙げられる。

【0015】Y、Y'及びY'で表される炭素数1~3 0の有機基としては、メチル、エチル、プロピル、イソ プロピル、ブチル、第二ブチル、第三ブチル、イソブチ ル、アミル、イソアミル、第三アミル、ヘキシル、シク ロヘキシル、シクロヘキシルメチル、2-シクロヘキシ 50 チン鎖又はトリメチン鎖を構成するものが選択され、と

ルエチル、ヘプチル、イソヘプチル、第三ヘプチル、n - オクチル、イソオクチル、第三オクチル、2 - エチル ヘキシル、ノニル、イソノニル、デシル、ドデシル、ト リデシル、テトラデシル、ペンタデシル、ヘキサデシ ル、ペプタデシル、オクタデシル等のアルキル基、ビニ ル、1-メチルエテニル、2-メチルエテニル、プロペ ニル、ブテニル、イソブテニル、ペンテニル、ヘキセニ ル、ヘプテニル、オクテニル、デセニル、ペンタデセニ ル、1-フェニルプロペン-3-イル等のアルケニル 基、フェニル、ナフチル、2-メチルフェニル、3-メ チルフェニル、4-メチルフェニル、4-ビニルフェニ ル、3-イソプロピルフェニル、4-イソプロピルフェ ニル、4-ブチルフェニル、4-イソブチルフェニル、 4-第三ブチルフェニル、4-ヘキシルフェニル、4-シクロヘキシルフェニル、4-オクチルフェニル、4-(2-エチルヘキシル) フェニル、4-ステアリルフェ ニル、2、3-ジメチルフェニル、2、4-ジメチルフ ェニル、2、5-ジメチルフェニル、2、6-ジメチル フェニル、3,4-ジメチルフェニル、3,5-ジメチ 例示したものが挙げられ、炭素数1~8のアルコキシ基 20 ルフェニル、2,4-ジ第三ブチルフェニル、シクロへ キシルフェニル等のアルキルアリール基、ベンジル、フ ェネチル、2-フェニルプロパン-2-イル、ジフェニ ルメチル、トリフェニルメチル、スチリル、シンナミル 等のアリールアルキル基等、これらがエーテル結合、チ オエーテル結合で中断されたもの、例えば、2-メトキ シエチル、3-メトキシプロピル、4-メトキシブチ ル、2-ブトキシエチル、メトキシエトキシエチル、メ トキシエトキシエトキシエチル、3-メトキシブチル、 2-フェノキシエチル、3-フェノキシプロピル、2-30 メチルチオエチル、2-フェニルチオエチルが挙げら れ、更にこれらの基は、アルコキシ基、アルケニル基、 ニトロ基、シアノ基、ハロゲン原子等で置換されていて もよい。

> 【0016】本発明に係るポリメチン化合物としては、 上記一般式(II)において、環Aが(a)又は(d)で 表され、環A'が(a')又は(d')で表されるもの が、感度がよいので好ましく、環Aが(a)で表され、 環A'が(a')で表されるものがより好ましく、

> (a)中のX及び(a')中のX'が、各々独立に、ブ -フェニルプロパン-1, 1-ジイル又はシクロヘキサ ン-1,1-ジイルであるものが更に好ましい。

> 【0017】また、本発明に係るポリメチン化合物にお いて、上記一般式(II)中の連結基Qは、使用する半導 体レーザの波長に合わせて適宜選択されるものである。 例えば、CD-Rに代表される750~830nmのレ ーザを用いる場合は、ヘプタメチン鎖又はペンタメチン 鎖を構成するものが選択され、DVD-Rに代表される 630~670nmのレーザを用いる場合は、ペンタメ

れらは、ポリメチン鎖中に環構造を含んでいてもよい。

【0018】上記連結基Qとしては、下記群IIIの

* [0019] 【化6]

(1)~(6)のいずれかで表される基が好ましい。 >

(式中、 R^{10} 及び R^{11} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、炭素数 $6 \sim 30$ のアリール基、ジフェニルアミノ基又は炭素数 $1 \sim 8$ のアルキル基を表し、Z は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、炭素数 $6 \sim 30$ のアリール基又は炭素数 $1 \sim 8$ のアルキル基を表す。)

【0020】上記群IIIの(1)~(6) において、R 10 及びR 11 で表される炭素数 $6\sim30$ のアリール基及び炭素数 $1\sim8$ のアルキル基としては、上記R 1 で例示したものが挙げられ、Zで表される炭素数 $6\sim30$ のアリール基及び炭素数 $1\sim8$ のアルキル基も同様である。

【0021】上記連結基Qとしては、上記群IIIの中で

※いので特に好ましい。

【0022】上記一般式 (II) におけるポリメチンカチオン部分の具体例としては、下記化合物 $No.1\sim61$ が挙げられる。

[0023]

【化7】

も、(1)又は(2)で表される基が、吸光係数が大き※

(化合物No. 3 (化合物No. 3 (化合物No. 3

[0025]

【化9】

30

** 【化名】

(た合物No. 18

(た合物No. 21

(た合物No. 22

(た合物No. 23

(た合物No. 25

(た合物No. 25

(た合物No. 25

(た合物No. 26

(た合物No. 26

(た合物No. 27

(た合物No. 27

(た合物No. 27

(た合物No. 26

(た合物No. 26

(た合物No. 27

(た合物No. 27

(た合物No. 27

(た合物No. 27

(た合物No. 28

(た合物No. 28

(た合物No. 29

(た合物No. 29

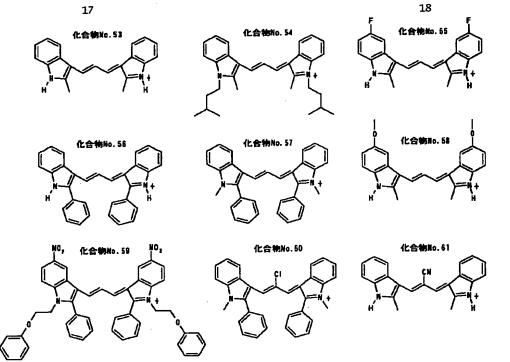
(た合物No. 20

(た合物No.

[0026] 40 [化10]

[0027]

【化11】



[0028] 本発明に係るポリメチン化合物は、その製造方法によって制限を受けるものではない。また、上記一般式(II)で表される本発明に係るポリメチン化合物も、その製造方法によって制限を受けるものではなく、従来周知の方法に準じて製造することができる。例えば、環構造を有する環状化合物と連結基鎖を導入するためのブリッジ剤化合物とを反応剤により反応させた後、アニオン交換を行うことで合成することができる。より 30

具体的には、本発明の好ましい形態である、環A及び環A'が各々(a)及び(a')であり、連結基Qが(1)又は(2)の場合は、下記のルートので合成され、環A及び環A'が各々(d)及び(d')であり、連結基Qが(1)又は(2)の場合は、下記のルートので合成することができる。

[0029]

【化12】

ルート①

$$(B_i) = \underbrace{\begin{array}{c} A_i \\ B_i \\ A_i \end{array}}_{X} + \underbrace{(B_{i,i}) L_i - \underbrace{\begin{array}{c} A_i \\ B_i \\ A_i \end{array}}_{X} - \underbrace{$$

ルート2

(式中、環B、環B'R¹、R²、R¹'、R²'、X、X'、Y、Y⁰、Y'、r、r' 及びZは、上記一般式(I)及び(II)におけるものと同様であり、Dは、ハロ ゲン又は置換スルホニルオキシを表す。)

【0030】上記ポリメチン化合物を含有してなる本発 適用されるが、該光学記録層の形成方法は特に制限を受 けない。一般には、メタノール、エタノール等の低級ア ルコール類;メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブ チルセロソルブ、ブチルジグリコール等のエーテルアル コール類;アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソ ブチルケトン、シクロヘキサノン、ジアセトンアルコー ル等のケトン類、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸メトキ シエチル等のエステル類: アクリル酸エチル、アクリル 酸プチル等のアクリル酸エステル類、2,2,3,3-・テトラフルオロプロバノール等のフッ化アルコール類; 50 る本発明の光学記録材料の使用量は、好ましくは50~

ベンゼン、トルエン、キシレン等の炭化水素類;メチレ 明の光学記録材料は、光学記録媒体の光学記録層として 40 ンジクロライド、ジクロロエタン、クロロホルム等の塩 素化炭化水素類等の有機溶媒に本発明に係るポリメチン 化合物を溶解した溶液を、基体上にスピンコート、スプ レー、ディッピング等で塗布する湿式塗布法が用いられ る。その他の方法としては、蒸着法、スパッタリング法 等が挙げられる。

> 【0031】上記光学記録層の厚さは、通常、0.00 $1\sim10\mu$ mであり、好ましくは0. $01\sim5\mu$ mであ

【0032】また、光学記録媒体の光学記録層中におけ

22

100質量%である。

【0033】また、上記光学記録層は、本発明の光学記 録材料の他に、必要に応じて、シアニン系化合物、アゾ 系化合物、フタロシアニン系化合物等の、光学記録層に 用いられる本発明に係るポリメチン化合物以外の化合 物:ポリエチレン、ポリエステル、ポリスチレン、ポリ カーボネート等の樹脂類;界面活性剤;帯電防止剤;滑 **剤: 難燃剤: ヒンダードアミン等のラジカル捕捉剤: フ** ェロセン誘導体等のピット形成促進剤:分散剤:酸化防 止剤:架橋剤;耐光性付与剤等を含有してもよい。 【0034】さらに、上記光学記録層は、一重項酸素等 のクエンチャーとして芳香族ニトロソ化合物、アミニウ

21

ム化合物、イミニウム化合物、ビスイミニウム化合物、*

* 遷移金属キレート化合物等を含有してもよく、クエンチ ャーアニオンを含有してもよい。これらは、上記光学記 録層中において好ましくは0~50質量%の範囲で使用 される。

【0035】上記のクエンチャーは、特開平5-104 861号公報、特開平5-294070号公報、特開平 6-199045号公報、特開平11-277904号 公報、特開2000-177248号公報等に記載され ており、例えば、下記一般式(A)で表されるものが挙 げられる。

[0036] 【化13】

(式中、R¹²~R¹⁵は、水素原子、水酸基、ニトロ基、ハロゲン原子、シアノ基、 アルキル基、フェニル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、モノアル キルアミノ基又はジアルキルアミノ基を表し、Annは、n価のアニオンを表し、 nは、1又は2の整数を表し、mは、電荷を中性に保つ係数を表す。)

(A)

【0037】上記一般式(A) において、An"で表さ れるアニオンとしては、例えば、一価のものとして、塩 素アニオン、臭素アニオン、ヨウ素アニオン、フッ素ア ニオン等のハロゲンアニオン:過塩素酸アニオン、塩素 酸アニオン、チオシアン酸アニオン、六フッ化リンアニ オン、六フッ化アンチモンアニオン、四フッ化ホウ素ア ニオン等の無機系アニオン;ベンゼンスルホン酸アニオ ン、トルエンスルホン酸アニオン、トリフルオロメタン スルホン酸アニオン等の有機スルホン酸アニオン;オク チルリン酸アニオン、ドデシルリン酸アニオン、オクタ デシルリン酸アニオン、フェニルリン酸アニオン、ノニ

ルフェニルリン酸アニオン、2,2'-メチレンビス (4,6-ジ第三ブチルフェニル) ホスホン酸アニオン 30 等の有機リン酸系アニオン等が挙げられ、二価のものと して、ベンゼンジスルホン酸アニオン、ナフタレンジス ルホン酸アニオン等が挙げられる。

【0038】上記のクエンチャーの具体例としては、下 記のクエンチャーNo. 1~3が挙げられる。なお、下 記のクエンチャーNo. 1~3は、アニオンを省いたカ チオンで表した。

[0039]

【化14】

[0040]また、クエンチャーアニオンは、特開昭60-234892号公報、特開平5-579号公報、特開平5-43814号公報、特開平6-239028号公報、特開平9-309886号公報、特開平10-45767号、特開平11-227331号公報等に記載*

* されており、例えば、下記一般式(B)又は(C)で表されるものが挙げられる。

[0041] [化15]

(式中、Mは、ニッケル原子、銅原子又は亜鉛原子を表し、 R^{16} 及び R^{17} は、ハロゲン原子、シアノ基、アルキル基、アリール基、 $-SO_2-Z$ 基を表し、Z'は、アルキル基、ハロゲン原子で置換されていてもよいアリール基、ジアルキルアミノ基、ジアリールアミノ基、ピペリジノ基、モルフォリノ基を表し、a及び bは、各々 $0\sim4$ を表す。また、 R^{18} 、 R^{19} 、 R^{20} 及び R^{21} は、各々独立に、ハロゲン原子、シアノ基、アルキル基、アルコキシ基、(ポリ)エーテル基、ジアルキルアミノ基、アルキルフェニル基、アルコキシフェニル基、ハロゲン化フェニル基、又は R^{18} と R^{10} 、 R^{20} と R^{21} とが各々連結して2-チオキソー1、3-ジチオキサン環を形成する基を表し、pは、1又は2を表す。)

【0042】上記のクエンチャーアニオンの具体例とし【0043】ては、下記のアニオンNo. 1~24が挙げられる。【化16】

[0044]

【化17】

$$7 = \pi \times No. 12$$

$$7 = \pi \times No. 13$$

$$7 = \pi \times No. 14$$

$$7 = \pi \times No. 15$$

$$7 = \pi \times No. 16$$

$$1 = \pi \times No. 17$$

$$1 = \pi \times No. 17$$

$$1 = \pi \times No. 18$$

$$1 = \pi \times No. 18$$

$$1 = \pi \times No. 18$$

$$1 = \pi \times No. 19$$

$$1 =$$

[0045]

$$P = \forall N \text{ O. } 23$$

NC
 $S = Z \text{ O.} S$
 $S = Z \text{ O.} S$
 $S = S \text{ O.} S$

【0046】本発明に係る光学記録層を設層する上記基 体の材質は、書き込み(記録)光及び読み出し(再生) 光に対して実質的に透明なものであれば特に制限はな く、例えば、ポリメチルメタクリレート、ポリエチレン テレフタレート、ポリカーボネート等の樹脂、ガラス等 が用いられる。また、その形状は、用途に応じ、テー ブ、ドラム、ベルト、ディスク等の任意の形状のものが 使用できる。

【0047】また、上記光学記録層上に、金、銀、アル ミニウム、銅等を用いて蒸着法あるいはスパッタリング 50 もって本発明を更に詳細に説明する。しかしながら、本

*【化18】

アニオンNo. 24

$$s = \left(\frac{1}{s} \right) \left(\frac{1}{s}$$

法により反射膜を形成することもできるし、アクリル樹 脂、紫外線硬化性樹脂等による保護層を形成することも できる。

【0048】本発明の光学記録材料は、記録、再生に半 導体レーザを用いる光学記録媒体の光学記録層に好適で あり、特にCD-R、DVD-R等の光ディスクの光学 記録層に好適である。

[0049]

【実施例】以下、製造例、実施例、比較例及び評価例を

発明は以下の実施例等によって何ら制限を受けるもので はない。

[0050] [製造例1] 化合物No. 6のジフェニルアミン-4-スルホン酸塩の製造

窒素置換した反応フラスコにN-メチルニトロインドレニントルエンスルホン酸塩7.81g、ジフェニルホルムアミジン1.96g、ビリジン15.8g、無水酢酸3.06gを仕込み、窒素気流下25℃で3時間撹拌した。これにクロロホルム50ml、ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム8.14g、水50mlを加10え30分撹拌した後に、クロロホルム相を分離した。これを水洗した後、脱溶媒して得えられた残渣をメタノールで再結晶し、結晶を4.52g(収率65.0%)を得た。これについて下記分析を行い、構造等を確認した。分析結果を以下に示す。(分析結果)

①純度: HPLC測定; 99.5%

②構造解析: H-NMR測定

(ケミカルシフトppm: 多重度; プロトン数)

(1.75; s; 12) (3.71; s; 6) $(6.63 \sim 6.72; d; 2)$ $(6.79 \sim 6.84; t; 1)$ $(6.95 \sim 6.97; d; 2)$ $(7.07 \sim 7.08; d; 2)$ $(7.20 \sim 7.24; t; 2)$ $(7.40 \sim 7.45; d; 2)$ $(7.67 \sim 7.70; d; 2)$ (8.23; s; 1) $(8.37 \sim 8.45; m; 3)$ (8.57; s; 2)

③光学的特性:メタノール溶媒でのUVスペクトル測定 λmax ; 562 nm、 ϵ ; 1.95×10

④熱分解開始温度:窒素気流中、10℃/分昇温での示差熱分析

269℃

【0051】[製造例2]化合物No.31のジフェニルアミン-4-スルホン酸塩の製造

窒素置換した反応フラスコにN-イソアミルベンゾインドレニントルエンスルホン酸塩9.03g、マロンジアルデヒドジアニリン塩酸塩2.596g、ピリジン15.8g、無水酢酸3.06gを仕込み、窒素気流下25℃で3時間撹拌した。これにクロロホルム50m1、ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム8.14g、水50m1を加え30分撹拌した後に、クロロホルム相を分離した。これを水洗した後脱溶媒して得えられた残渣をメタノールで再結晶し、結晶を5.99g(収率71.0%)を得た。これについて下記分析を行い、構造等を確認した。分析結果を以下に示す。

(分析結果)

O 純度: HPLC測定: 99.6%

②構造解析: 1H-NMR測定

(ケミカルシフトppm;多重度;プロトン数)

(0. $95\sim1$. 01; d; 12) (1. $57\sim1$. 6 3; q; 4) (1. $73\sim1$. 84; m; 2) (1. 9 5; s; 12) (4. $18\sim4$. 23; t; 4) (6.

)

 $31\sim6.$ 35;d;2) $(6.62\sim6.69;t;1)$ $(6.79\sim6.83;t;1)$ $(6.91\sim6.99;d;2)$ $(7.02\sim7.07;d;2)$ $(7.17\sim7.24;t;2)$ $(7.39\sim7.45;d;2)$ $(7.47\sim7.53;t;2)$ $(7.65\sim7.74;m;4)$ $(8.00\sim8.10;t;4)$ $(8.20\sim8.26;s+s;3)$ $(8.43\sim8.50;t;2)$

③光学的特性:メタノール溶媒でのUVスペクトル測定 λmax;680nm、ε;2.30×10⁵

④熱分解開始温度:窒素気流中、10℃/分昇温での示差熱分析

248℃

【0052】 [製造例3] 化合物No. 7のジフェニルアミン-4-スルホン酸塩の合成

N-メチルニトロインドレニントルエンスルホン酸をN- [2-(4-イソプロポキシフェニル)エチル]ニトロインドレニントルエンスルホン酸に換えた以外は、上記の製造例1と同様の方法により、目的物を合成した。20 分析結果を以下に示す。

(分析結果)

O純度: HPLC測定; 99. 7%

②構造解析:¹H-NMR測定

(ケミカルシフトppm:多重度;プロトン数)

(1. 06~1. 10; d; 12) (1. 67; s; 1 2) (3. 01~3. 05; t; 4) (4. 42~4. 49; m; 6) (6. 43~6. 47; d; 2) (6.

73~6.77;d;4) (6.79~6.84;t;

1) (6. 94~6. 97; d; 2) (7. 05~7.

08;d;2) (7. 17~7. 18;d;4) (7. 20~7. 24;t;2) (7. 41~7. 44;d;

2) (7. 52~7. 55; d; 2) (8. 18~8. 31; m; 4) (8. 56; s; 2)

③光学的特性:メタノール溶媒でのUVスペクトル測定 λmax ; 573 nm、 ϵ ; 1.76×10°

◆熱分解開始温度:窒素気流中、10℃/分昇温での示差熱分析

271°C

【0053】 [製造例4] 化合物No. 36のジフェニルアミン-4-スルホン酸塩の合成

窒素置換した反応フラスコに2-ナフチルヒドラジン3
0.1g、エタノール94.8gを仕込み、70℃まで加温してから、アセチルシクロヘキサン48.0gを5分で滴下した。更に硫酸39.2gを加え3時間反応させた後、エタノールを留去し、トルエン500m1、20質量%水酸化ナトリウム水溶液200gを加え、油水分離した。油相を洗浄水が中性になるまで水洗し、硫酸ナトリウムで乾燥後脱溶媒して得た残渣を60℃のトルエン94gで溶解させた溶液に、N-ヘキサン94gを50加えて晶析を行い、結晶を濾取、乾燥して中間体(A)

を27.2g得た。窒素置換した反応フラスコに、中間 体(A) 25. 0gとヨウ化メチル17. 1gを仕込 み、110℃で4時間反応させた後、酢酸エチル10 2. 4gを滴下し30分還流させ、冷却した。固相を濾 取し、洗浄、乾燥を行い中間体(B)を27.2g得 た。窒素置換した反応フラスコに中間体(B)11.8 g、ピリジン23.7gを仕込み50℃まで加温した系 に、無水酢酸3.1gに下記原料化合物5.00gを溶 解させた溶液を30分で滴下した後、70℃で2時間反 応させた。この系にジフェニルアミン-4-スルホン酸 10 ナトリウム5.10g、メタノール35.6gを加え1 時間還流させた。反応系を冷却後、析出した結晶をメタ ノール、水で洗浄した後乾燥させて、目的物の結晶2. 84g(収率35.3%)を得た。これについて下記分 析を行い、構造等を確認した。分析結果を以下に示す。 (分析結果)

①純度: HPLC測定: 99.6%

②構造解析: 1H-NMR測定

(ケミカルシフトppm;多重度;プロトン数)

 $*(1.73\sim1.92;m;6)(1.95;s;6)$ $(1.99\sim2.08; m; 2)$ $(2.45\sim2, 5)$ 8;m;2) (3.69;s;3) (3.96;s; 3) $(6.27\sim6.32;d;1)$ $(6.58\sim6.$ 63;d;1) (6. 69~6. 76;t;1) (6. 79~6.84;t;1) (6.91~6.97;d; 2) $(7.05\sim7.11;d;2)$ $(7.19\sim7.$ 24; t; 2) (7. $39 \sim 7$. 45; d; 2) (7. $46\sim7.53;q;2)$ (7. $62\sim7.69;q;$ 2) $(7.71 \sim 7.75; d; 1)$ $(7.78 \sim 7.$ 82;d;1) (8. 02~8. 11;m;4) (8. $21 \sim 8.33 : m : 5$

③光学的特性:メタノール溶媒でのUVスペクトル測定 $\lambda \max : 678nm, \epsilon : 1.98 \times 10^{\circ}$

Φ熱分解開始温度:窒素気流中、10℃/分昇温での示 差熱分析

222°C [0054]

【化19】

原料化合物

【0055】[実施例1~6]光学記録媒体の製造及び 適正記録光波長評価

チタンキレート化合物 (T-50:日本曹達社製)を塗 布、加水分解して下地層(0.01μm)を設けた直径 12 cmのポリカーボネートディスク基板上に、化合物 30 No. 4、6、7、22、31又は36のジフェニルア ミン-4-スルホン酸塩の2,2,3,3-テトラフル オロプロパノール溶液(濃度2.0質量%)をスピンコ ーティング法にて塗布して、厚さ100nmの光学記録 層を形成し、光学記録媒体を得た。これらの光学記録媒 体について、光学記録ディスクに現在用いられている記※

※録光の波長について、UVスペクトル吸収の測定を行 い、適正記録光波長の評価を行った。各光学記録媒体の λmaxの強度を1として、これに対する相対強度が 0.15より小さいと記録及び再生の特性が悪化し、 0.50を超えると記録層の耐光性が悪くなり、記録の 保存安定性が悪くなる。従って、上記相対強度が、好適 な範囲である0.15~0.50を示すものを適正記録 光波長とした。結果を表1に記す。

[0056] 【表1】

	ポ リメチンカチオン	λ max (nm)	適正記録光波長(相対強度)			
実施例1	化合物 No.4	609	635nm(0.385), 650nm(0.169)			
実施例 2	化合物 No.6	603	635nm(0.344), 650nm(0.172)			
実施例3	化合物 No.7	605	635nm(0.377), 650nm(0.162)			
実施例 4	化合物 No.22	610	635nm(0.454), 650nm(0.195)			
実施例 5	化合物 No.31	715	770nm(0.267), 780nm(0.203), 790nm(0.165)			
実施例 6	化合物 No.36	717	770nm(0.335), 780nm(0.245), 790nm(0.194)			

【0057】[評価例1及び比較評価例1]耐光性評価 チタンキレート化合物 (T-50:日本曹達社製)を塗 布、加水分解して下地層(0.01μm)を設けた直径 12cmのポリカーボネートディスク基板上に、表2に 記載のポリメチン化合物の2,2,3,3-テトラフル オロプロパノール溶液(濃度2.0質量%)をスピンコ 50

ーティング法にて塗布して、厚さ100mmの光学記録 層(薄膜)を形成し、光学記録媒体を得た。これらの光 学記録媒体について、キセノン耐候性試験器(テーブル サン:スガ試験機(株)社製)を用いて、55000ル クスの光を20時間照射し、薄膜のλ *** における塗布 成膜直後の吸光度A'と照射後の吸光度Aとの比A/

A' (%)を色素残存率として耐光性評価を行った。結 * [0058]

果を表2に示す。

【表2】

		1	ずりメチン化合物	薄膜の	色素残存率	
		ポリメチンカチオン	アニオン	λ max	(%)	
837	1 - 1	化合物 No.4	シ フェニルアミン・4・スルホン酸アニオン	609nm	63	
評価	1 - 2	化合物 No.6	シ フェニルアミン・4・スルホン酸アニオン	603nm	88	
例	1-3	化合物 No.7	シ フェニルアミン・4・スルホン酸をアニオン	605nm	86	
	1 – 4	化合物 No.22	シ フェニルアミン・4・スルホン酸アニオン	610nm	89	
比	1 – 1	化合物 No.4	PF ₆	610nm	51	
較評	1 - 2	化合物 No.6	ClO ₄ -	623nm	78	
価例	1 - 3	化合物 No.7	ClO ₄ -	604nm	68	
	1 - 4	化合物 No.22	PF ₆	610nm	75	

【0059】 [評価例2及び比較評価例2] 耐光性評価 下記表3及び4に記載の配合によりテトラフルオロブロ パノール溶液(トータル濃度1.5質量%)を調製し、 上記評価例1と同様に光学記録媒体を製造し、耐光性評 ※4中のクエンチャーNo. 3のアニオンとしては、六フ ッ化アンチモンを用いた。

[0060]

【表3】

価を行った。結果を表3及び4に示す。なお、表3及び※

	**リバン化合物(a)		AT. 1. (1. A. 54. 0.)	質量比	薄膜の	色素残存率
···	ポリメチンカチオン	アニオン	クエンチャ-化合物(b)	(a:b)	λmax	(%)
評価例 2-1	化合物 No.31	ジ フェニルアミン ・4・スルホン酸アニオン	クエンチャ- No.3	90:10	711nm	75
比較評価例 2-1	化合物 No.81	p・トルエンストホン酸 アニオン	_	_	714nm	3.5
比較評価例 2·2	化合物 No.31	p-トルエンスルホン酸 アニオン	クエンチャー No.3	90:10	711nm	66

[0061]

★ ★【表4】

	ポリメチン化合物(a)		ATTAL (VAHO)	質量比	薄膜の	色素残存率
	ポ リメチンカチオン	アニオン	クエンチャ-化合物(Ъ)	(a:b)	λmax	(%)
評価例 2-2	化合物 No.36	ジ フェニルアミン ・4・スルネン酸アニオン	クエンチャ・No.3	90:10	715nm	78
比較評価例 2-3	化合物 No.36	p-トルエンスルホン酸 タニオン	_		718nm	2.0
比較評価例 2-4	化合物 No.36	p-トルエンスルホン酸 アニオン	クエンチャー No.3	90:10	715nm	63

[0062]

☆記録媒体用の光学記録材料を提供できるものである。

【発明の効果】本発明は、充分な光堅牢性を有する光学☆

フロントページの続き

(72)発明者 岡田 光裕

東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電

化工業株式会社内

(72)発明者 伏見 友紀

東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電

化工業株式会社内

F ターム(参考) 2H111 EA03 EA12 EA22 EA25 EA39

4H056 CA01 CC02 CC08 CE03 DD03

FA06

5D029 JA04 JC17